

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年10月21日 (21.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/090959 A1

(51) 国際特許分類: H01L 21/205, 21/31, 21/22, 21/324

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/004454

(22) 国際出願日: 2004年3月29日 (29.03.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-097672 2003年4月1日 (01.04.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 斎藤 幸規 (SAITO, Takanori) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP).

Takanori) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 斎藤 和秀 (SERIZAWA, Kazuhide) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 市川 貴 (ICHIKAWA, Takashi) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP).

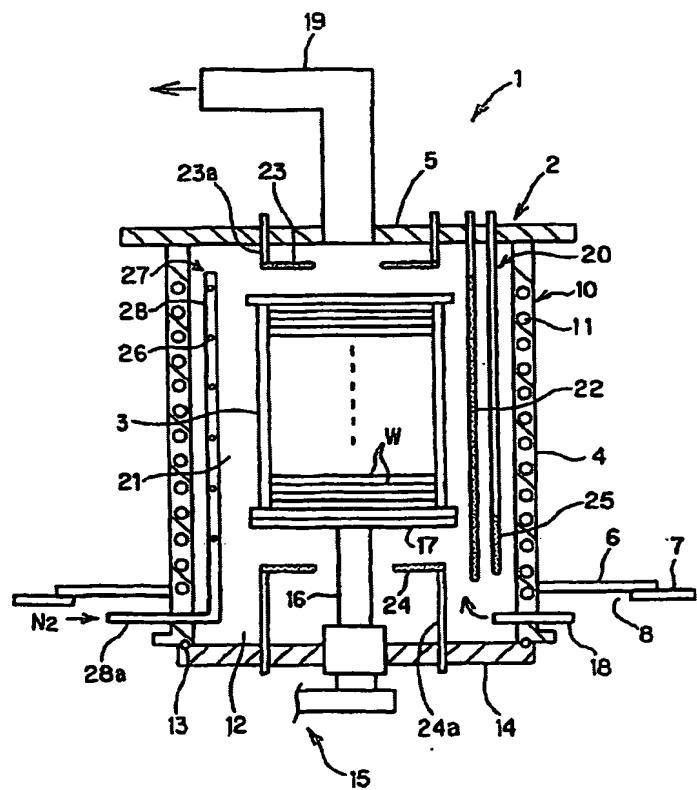
(74) 代理人: 吉武 賢次, 外 (YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

/締葉有/

(54) Title: METHOD OF HEAT TREATMENT AND HEAT TREATMENT APPARATUS

(54) 発明の名称: 热処理方法及び热処理装置



(57) **Abstract:** A method of heat treatment characterized by comprising the step of in a metallic treating vessel furnished with heating means thereinside, carrying out given low-temperature-range heat treatment of multiple workpieces held in multistage by the use of the heating means and the step of after the completion of the heat treatment, introducing cooling gas in individual regions of the treating vessel divided in the direction of height of the workpieces.

(57) **要約:** 本発明は、内部に加熱手段が設けられた金属製の処理容器において、多段に保持された複数の被処理体に対して、前記加熱手段によって低温域の所定の熱処理を実施する工程と、前記熱処理の終了後に、前記被処理体の高さ方向に分割された前記処理容器の各領域に冷却ガスを導入する工程と、を備えたことを特徴とする熱処理方法である。